

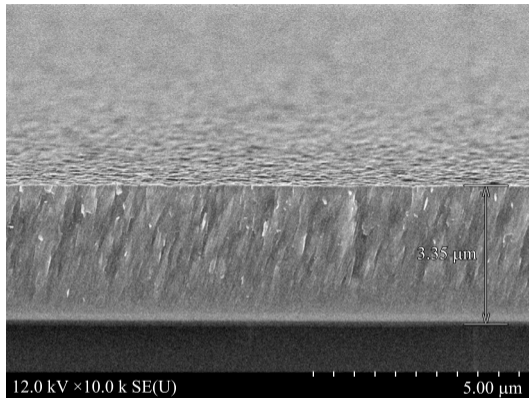
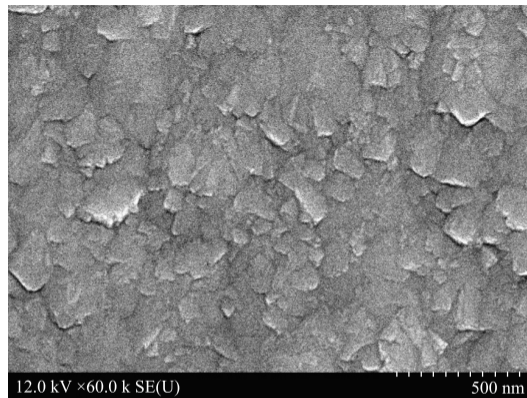
a/a*б/б*

Рис. 6. СЭМ-микрофотографии поверхности (*а*) и скола (*б*) покрытия TiAlCN, сформированного на кремниевой подложке в режиме 3 с соотношением парциальных давлений азота и ацетилена $P_{N_2} : P_{C_2H_2} = 1 : 2$

Fig. 6. SEM micrographs of the surface (*a*) and cleavage (*b*) of TiAlCN coating formed on silicon substrates in regime 3 with the ratio of partial pressures of nitrogen and acetylene $P_{N_2} : P_{C_2H_2} = 1 : 2$